

研究室向け簡易マスク作製機

MM605

新製品
ニュース

大切なマスクはお手元で！
ローコストで手軽にマスク製作
多品種のデバイス開発に最適

1/5縮小露光フォトマスク作製機

各種半導体・MEMS微小構造物製作のためにはフォトマスクが欠かせません。特に大学・研究所においては多種のマスクが必要となります。本装置は研究室レベルで簡単にフォトマスクを作製するための装置です。お手持ちのグラフィックソフトやCADシステム等でプリントした図面をOHPフィルムにコピーしマスク原版として使用します。

MM605では特別に設計された光学系でマスク原版を高精度に1/5縮小投影し、エマルジョンマスクを作ります。今まで外部委託に頼っていたマスク製作をお手元で手軽に安価で作る事ができます。改変の多い研究には特にお勧めです。デザインも縦型スタイルで設置スペースをとりません。

【主な仕様】

◆縮小レンズ部

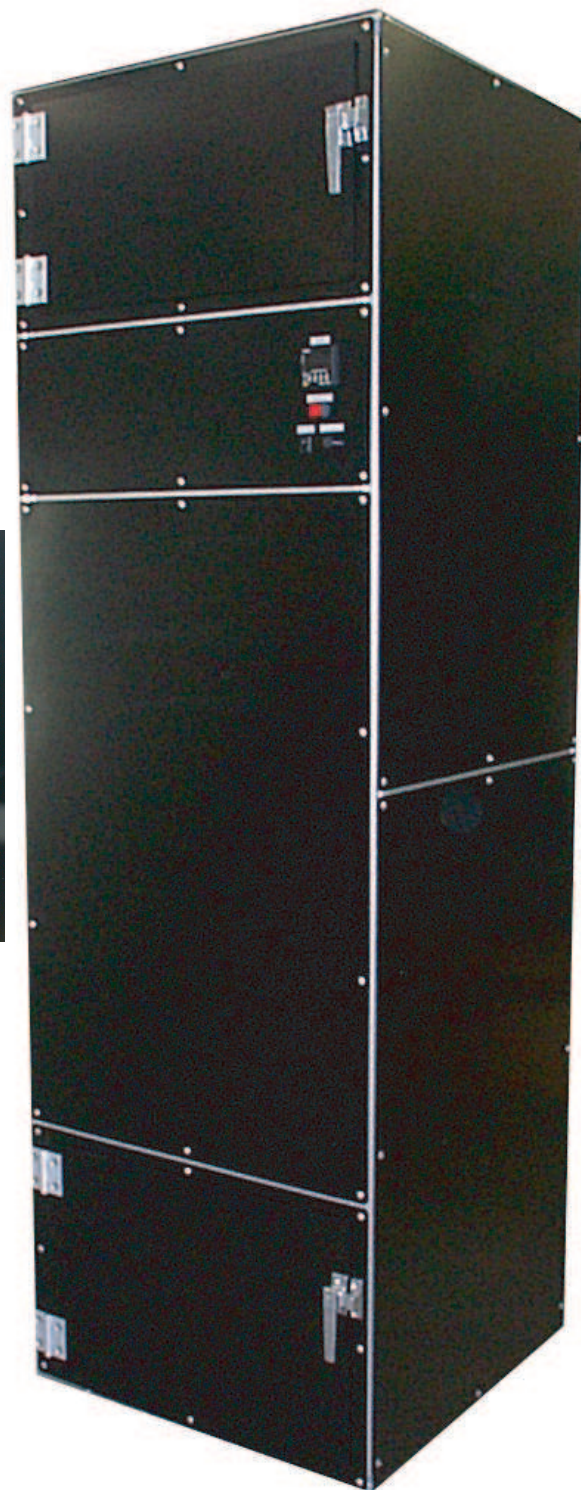
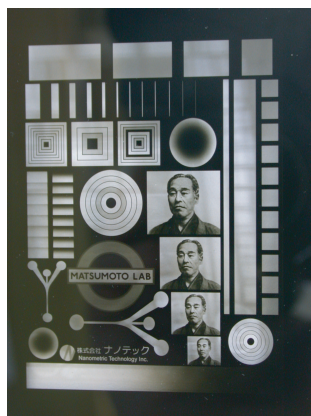
倍率	0.2倍
撮像寸法	59.4×59.4mm
視野寸法	297×297mm
物体距離	1195.5mm
物体間距離	1455.5mm
実行F値	(像側) 5.487 (物側) 27.317
分解能	(像側) 3.017 μm (物側) 15.024 μm
($\lambda = 550\text{nm}$)	
周辺光量	95.19%
TV dist	-0.0263%

◆照明部

蛍光灯	30w 3本
光調整	可
光強度	(max) 1215Lx ~ (min) 749Lx
光分布	1.004%

◆露光タイマー

◆電 源	100V 3A 50/60Hz
◆外形寸法	610×610×1975mm
◆重 量	約 80kg



改良のため仕様・意匠は変更されることがあります

写真提供 慶應義塾大学理工学部 物理情報工学科 松本研究室

特約店

SANMEI GROUP IDENTITY

sanmei 株式会社 三明

〒424-0825 静岡県静岡市清水松原町6-16
電話 (0543)53-3271 Fax (0543)52-1648

製造元



株式会社 ナノテック
Nanometric Technology Inc.

〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-5-8-201

www.nanotech-inc.co.jp
info@nanotech-inc.co.jp

電話 (03)3960-3171 Fax (03)3960-3174